

Saphier 330是一款用于为 \varnothing 200 - 250 mm的工作盘径的双盘研磨抛光机。超强、步进控制的驱动允许应用于所有的工作步骤。

抗冲击塑料内罩、采用粉末涂层的铝制外罩以及设备的高标准技术赋予了其安静、平稳运行的特点。



可变速度

可变转速由旋转开关决定。在工作循环周期中，转速也可以改变。在整个转速范围内，可保持恒定的较高扭矩。

水

供水通过手动开关控制。冲洗龙头可以拉出，通过软管扩展清洁内罩。通过在左右旋转龙头可以实现在工作盘上水流的最佳分配。





基本模块

SAPHIR 330

订货号: M5630020

- » 单盘研磨抛光机
- » 可变转速
- » 铝制机架, 粉末涂层
- » 耐冲击塑料内罩
- » 手动水电磁阀控制
- » 废料收集盘
- » 包括溅油环和外上盖

设备

电源 (可选)

选项 1

230 V/50 Hz (1/N/PE)

订货号: A5630003

选项 2

110 V/60 Hz (1/N/PE)

订货号: A5630004

附件

废料沉淀槽

- » 双格室, 粉末涂层, 45 L
- » 溢流装置和滤网
- 适用于系统实验室
(可插入系统实验室橱柜)
- 订货号: A5800029



移动式

订货号: A5800051



系统实验室橱柜

订货号: M5800042

- » 系统实验室装配
- » 宽x高x深 880x800x800 mm

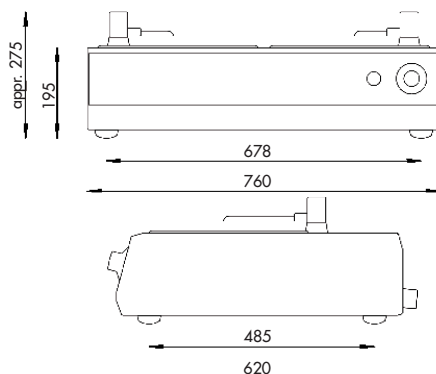


连接套件

订货号: Z5600008

- » 1 根排水管 \varnothing 40 mm; 1.5 m
- » 1 根压力管 R 1/2"; 2 m

技术参数



磨抛盘直径	\varnothing 200 - 250 mm
主载	1.5 kVA
电源	1 230 V/50 Hz (1/N/PE)
	2 110 V/60 Hz (1/N/PE)
速度	50 - 600 rpm
宽x高x深	大约760 x 195 x 620 mm
重量	44 kg